GAS SUPPLY PROCESS AND APPARATUS

Patent number:

JP48093596

Publication date:

1973-12-04

Inventor: Applicant:

Classification:

C01B13/22; C01B13/20; (IPC1-7): C01G1/02

- european:

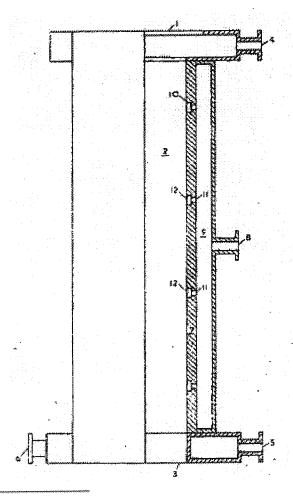
C01B13/22

Application number: Priority number(s): JP19730010627 19730125 GB19720007570 19720218 Also published as:

NL7300458 (A)
GB1358224 (A)
FR2172098 (A1)
DE2254859 (A1)
BE794694 (A)

Report a data error here

Abstract not available for JP48093596 Abstract of corresponding document: GB1358224 1358224 Gas contact apparatus BRITISH TITAN Ltd 28 Sept 1972 [18 Feb 1972] 7570/72 Heading B1F [Also in Division CI] Metal oxides are produced by vapour phase oxidation of metal halides by introducing into one end (1) of a reaction zone (2) a hot stream of primary gas consisting of inert gas, oxidising gas or metal halide, and introducing into the primary stream from a plurality of apertures (10) a secondary gas consisting of oxidising gas and/or metal halide, the apertures being fed from a manifold (9) such that the gas cools the reactor walls before injection and having a larger cross-sectional area at their outlet end (12) than at their inlet end (11). The primary gas may be heated by an electric arc or by pre-combustion. The increase in the crosssection of the apertures may be stepped or gradual and may be from .01-.2" to .05-.5" in diameter.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

公 報 (B2) 許 特

昭55-25125

60 Int.Cl.3

C 01 B 13/24

C 01 G 23/07

識別記号

庁内整理番号

7059-4G 7202-4G 2040公告 昭和55年(1980) 7月3日 Date of publication of potent: 1 July 3, 1920 発明の数

(全5頁)

1

60微分金属酸化物の製造法

21)特

昭 48-10627

22出

昭48(1973)1月25日

JP-A &

昭48-93596

48 (1973) 12月4日

優先権主張 1972年2月18日33イギリス(G B) 317570/72

何発 明 者 ケネス・アークレス

ツ クトン・オン・テイース・イーグルス クリック・ヤーム・ロード・ハイ フィールド・ガーデンズ 1

⑪出 願 人 チオクサイド・グループ・リミテ ッド

> イギリス国ロンドン・ダブリユ 1 エイ4エツクスピー・ストラツ トン・ストリート10

個代 理 人 弁理士 浅村皓

外3名

劒特許請求の範囲

1 対応する金属ハロゲン化物の酸化によつて微 粉金属酸化物を製造する方法であつて、反応帯の 一端に不活性ガス、酸化性ガスもしくは金属ハロ ゲン化物より成る高温度の第1ガス流を導入する 25 段階と、前記第1ガス流中へ前記反応帯の少くと も 一部分を取巻き、複数個の孔を含有する噴射装 置を通つて酸化性ガスおよび/または金属ハロゲ ン化物より成る第 2 ガスを導入する段階とを包含 し、前記第2ガスは前記噴射装置の壁を冷却し、 30 の欠点を有していることが現在判明するに至つた。 その際前記孔を通つて第1ガス流の中へ通過する 前に予熱されるような態様で前記反応帯に供給さ れ、又前記孔はその長さに沿つて少くとも2つの 異なる断面積を有するように形成され、その小さ い方の断面積部分は前記第2ガス用の孔の入口端35方法であつて、反応帯の一端の中へ不活性ガス、 に存在することを特徴とする微粉金属酸化物の製 造方法。

発明の詳細な説明

本発明は高温度で対応する金属ハロゲン化物を 酸化することによつて、細分化された金属酸化物 の製造に適する方法と装置に関する。

2

本出願人の特公昭49-30916公報には、 高温において対応するハロゲン化物の蒸気を酸化 することによつて、細分化されれ金属酸化物の製 造の方法と装置が記載されている。この明細書の 特許請求の範囲の方法と装置は、反応帯の一端に イギリス国テイースサイド・スト 10 (不活性ガスもしくは反応体の一つである)アー ク加熱の第1ガスを導入し、更に噴射器を通じて (酸化性ガスおよび/または金属ハロゲン化物で ある)第2ガスを第1ガスの中へ導入することを 指向するもので、前記噴射器は前記反応帯の壁の 15 少くとも一部分を形成し、従つて第1ガス流を包 囲し、又孔を備えていて、その孔を通つて第2ガ スが反応帯に入る前に、前記噴射装置の壁を冷却 するような態様でしかくすることにより、予熱さ れる)供給された後に第2ガスが入ることになつ 20 ている。特公昭 4 9 - 3 0 9 1 6号公報の第 5 図 および第6図は、その明細書の実施例1および2 に記載されているとれらの図面に示された前記装 置および該装置の操業方法の好適な実施例を示し ている。

> 特公昭 49-30916号公報に記載されたも のと同一の装置と方法は、若干欠点を有しており、 特に第5図および第6図に示された如き噴射装置、 例えばその長さを増加する装置と、該装置の壁に 沿つて隔置された多数の穴を設けている点に若干

本発明の目的はこれらの欠点を軽減もしくは排 除する装置と方法を提供することである。

従つて、本発明は対応する金属ハロゲン化物の 酸化によつて細分化された金属酸化物を製造する もしくは酸化性ガス、又は金属ハロゲン化物より 成る第1ガスの高温流動体を導入する段階と、前

記反応帯の少くとも一部を取巻き、又複数個の孔 を包含する噴射装置を通つて、第1カス流の中へ 酸化性ガスおよび/または金属ハロゲン化物より 成る第2ガスを導入する段階とを包含し、前記第 2ガスは前記噴射装置の壁を冷却する如き態様で 5 反応帯に供給され、それによつて第2ガスが前記 孔を通つて第1ガス流の中へ通過する前に予熱さ れ、又前記憤射装置の中の孔はその長さに沿つて 少くとも2つの異なる断面積を有するように形成 する孔の入口の末端に存在する特徴を有している。 本発明は、また金属ハロゲン化物の酸化に適す る装置を包含し、該装置は対向端に入口と出口を 有し、且複数個の孔を有する噴射装置によつて少 は蒸気が前記孔を通じて反応器に入る前に、噴射 装置の壁の少くとも一部分の上を通過する如き態 様でガスもしくは蒸気を前記反応器に供給する装 置とを包含し、前記噴射装置の孔はその長さに沿 形成され、その小さい方の断面積部分は、ガスも しくは染気のための孔の入口の末端に存在する特 徴を有している。

前記特公昭 49-30916号公報、特にその 明細書の第5図、第6図に記載のタイプの装置は、25 第2ガスが第1ガスの流れに入つて行く孔の端縁の まわりに金属酸化物がかなり附着するという欠陥 があることが判明した。この問題は特に多数の孔 を有する長い噴射装置を使用する場合に顕著であ る。との少くとも一つの理由は、第1ガスの入口 30 とれらの範囲内の推賞される圧力降下は操業規模 と反応生成物の出口との間の本質的な圧力降下に あると信じられるが、前記反応生成物は、噴射装 置の周辺の孔を通るガスの満足な分散を確保する ためには、短い噴射装置におけるよりも高速度で 第 2 ガスが前記孔を通つて導入されることを必要 35 の速度を所要数値に减少するために十分の長さだ とするものである。しかし前記孔からの第1ガス 流に入る第2カスの流速が大であればある程、そ の点において渦流を生じ、又混合反応体の再循環 を引起す傾向があり、これによつて順次該反応体 が噴射装置の壁に衝突し、特に前記孔の周辺に金 40 ンチ)範囲内の数値に、好適には 2.5 4 ㎜乃至 属酸化物の析出および附着をもたらす結果となる。

現在では、第2ガスが満足な分散のために所要 の速度で孔に入つた後に、第1ガス流に入る前に そのガス旒の速度を落とす装置が作られるならば

この欠陥は避け得られることが判明した。前記孔 の内部における前記ガス流の威速は、前記孔の最 初の部分間の孔の断面積を増加することによつて 達成されるが、該孔の断面横はすべての孔ならび に第1ガス流への出口のオリフイスを通る第2ガ スの所望の分散を確保するために慎重に決定され

前記孔を通る第2ガスの所望の分散を確保する ために必要な孔の最初の部分の断面積は、例えば され、その小さい方の断面積部分は第2ガスに対 10 噴射装置内のガス圧力、使用できる孔を通つて導 入される第2ガスの容量、および第2ガスが前記 孔に最初に供給され得る圧力等の多くの要因によ つて決定されるので、従つてこの数値の正確な数 字を出すことは不可能である。しかし一般に前記 くとも一部取巻かれている反応器と、ガスもしく 15 最初の部分が 0.2 5 4 ㎜から 5.0 8 ㎜(0.0 1 イ ンチから 0.20インチ)、特に 0.254㎜から 2.54㎜(0.01インチから0.10インチ)、好 適には 0.5 0 8 ㎜から 2.5 4 ㎜(0.0 2 インチか ら0.10インチ)特に0.508㎜から1.524㎜ つて少くとも 2 つの異なる断面積を有するように 20 (0.0 2 インチから 0.0 6 インチ)の範囲の直径 を有する円形オリフイスである如き孔を設けると 好都合であることが判明した。勿論これらの孔は 必ずしも円形でなければならぬ必要がなく、ただ 製作が容易であるために推賞されるだけである。

> 通常前記孔の最初の部分のサイズ即ち小さい方 の直径は、その孔のこの部分における圧力降下が 0. 0 0 7 Kg/cmt 5 0. 7 Kg/cm^2 (0. 1 ~ 1 0 p. s.i)、特に0.035 Kg/cm2 から0.350 Kg/cm2 (0.5~5 p. s. i) になるように選択されるが、 によつて決まるものである。

通常、前記孔の最初の部分は、その孔の長さの 10%から50%の一定の断面積部分であり、こ れによつて前記断面積は十分に増加され、又ガス け増加される。繰返し述べるが、これらの寸法は あらゆる場合するように規格化することが困難で あるが、一般に前記孔の残孔の残余長さについて は、1.27mm乃至12.7mmの(0.05~0.50イ 7.62mm(0.10~0.30インチ)の範囲内の数 値に、例えば大きい方の孔の直径を少くとも1.5 倍、好適には3倍の長さだけ、前記孔(円形の場 合)の直径を増加することによつて断面積を増加 5

することが一般に適当であることが判明した。

前記孔の断面積は、最初の入口のオリフイスに 従つて増加されるべきであるということは、本発 明の目的のために重要であるが、通常前記孔に沿 つて僅かに 2つの異なる断面積があるに過ぎない。5 しかし、もし所望ならば断面積を 2倍以上に、例 えば 3倍もしくは 4倍にも増加してもよく、もし 所望ならば小さい方の断面積から第1ガス流中へ の出口小孔まで連続的に増加するようにしてもよ No.

前記噴射装置の盆は、製作の容易性と良好な熱 伝導性の理由から金属製である。特に適当な金属 はアルミニウム、ニツケルおよびこれらの金属の 合金又はステンレス鋼である。

数群の孔は、例えば該単一群もしくは複数群の孔 を取巻くジャケツトを径由して、共通の多岐管に よつて供給されることも又望ましいが、これは単 一もしくは複数の第 2ガスの供給に要する配管工 事を簡単にし、前記噴射装置の壁の冷却を改善す 20 環された残部ガスと混合することによつて、最初 るからである。

特に長い噴射装置を使用する場合には、膨張と 収縮の問題が起るが、これらは適当な装置、例え は " 階段 " を備え、その階段と階段間では膨張が 可能の如く、区画された噴射装置の壁を作つて膨 25 ロゲン化物は一層酸化されて対応する金属酸化物 張に対して備えることにより回避することができ る。とのような階段はもし所望ならばばねの上に 乗せられたものでもよい。同様に単一もしくは複 数の第2ガスが前記孔に入る前に供給される周囲 を取巻くジャケツトは、膨張と収縮に順応するた 30 用金属酸化物である場合には、分級、被機、使用 めに(これ又ばねに乗せられた)ベローの形をし ていてもよい。

第 2ガスは、例えば酸素と 4塩化チタンの如き (もし所望の場合には4塩化シリコンおよび/ま たは塩化アルミニウムの如き追加剤を加えて)予 35 即ち反応器 2の中へ入り、しかる後出口 3を通つ め混合された酸化性ガスと金属ハロゲン化物か、 もしくは酸化性ガスもしくは金属ハロゲン化物よ り成つているかの何れかである。(前記酸化性ガ スもしくは金属ハロゲン化物は、同一噴射装置内 の異なる群の孔を通つて別個に導入されてもよく 40 するため冷却剤が5に導入され、6から排出され また所望ならば前綿追加剤を夫々含有してもよい。) もし第1カスが単に熱媒体として使用される不 活性ガスである場合は、その時は双方の反応体は 当然前記噴射装置を通つて普通の状態で導入され

る。もし前記反応体の一つが第1ガスを構成して いるならば、その際は一反応体のみが噴射装置を 通つて導入される必要がある。しかし一反応体の 一部、例えば酸素を第1ガスとして使用し、残部 の酸素および金属ハロゲン化物を、(金属ハロゲ ン化物が 4 塩化チタンである場合には、塩化アル ミニウムおよび/または4塩化シリコンを適当に 添加して)前記噴射装置を通じて予め混合および /または別々に導入することが推賞される。

第1ガスは前記特公昭49-30916号公報 に記載し、且特許請求の範囲とした如く電弧加熱 することが望ましいが、必ずしもそりする必要は ない。例えば前記第1ガスは一酸化炭素もしくは 炭化水素の燃焼生成物の如く金属ハロゲン化物の 同一の第2ガスが導入される単一群もしくは複15酸化を始めさせ、そしてその酸化を維持すること ができる何れか適当なガス組成より成つていても よいが、しかし後者の場合は水が存在する場合に は、好ましくない塩化水素を生成する結果となる。

反応生成物は、例えば第1冷却器で、次に再循 に冷却した後、ソツク・フイルター(Sock fiー lters)の如き通常の方法によつて収集すること が望ましい。別法として前記反応生成物を反応器 の中へ通過させてもよく、該反応器中では金属へ となる。かかる場合には、本発明による反応生成 物は金属ハロゲン化物の次の酸化の核となること ができる。

最後に、前記生成物は 2酸化チタンの如き顔料 前の乾燥および/または微粉砕の如き通常の後処 理が使用に先だつて施されるのが普通である。

添附図面は本発明の一実施例を示し、この実施 例では高温の第1ガスが入口1を通つて噴射装置 て出て行く。前記装置の表面に第 1 ガスによる附 着を起さないよりに保持するため 4を通つてガス の一掃が実施され、前記噴射装置の壁7に対して 如何なるその後の反応からも熱の移動を最少限に る。第2ガスを形成する予め混合された反応体は 8を通じてジャケット9の中へ導入されるが、該 ジャケット内では第 2ガスが前記噴射装置の壁の 表面を越えて流れ、孔10を経由して高温の第1

ガスを含有する反応器中に入る前に、前記壁の表 面を冷却する。孔10は図示されているものと同 一断面積の各水準においては孔の数を略図的に示 しており、この図では前記反応体は小さい方の断 トから入り、オリフイス12を通つて前記孔から 出て(前記反応体がオリフィス11から出た時と 比較して減少した速度で)反応器の中へ入る。

次の実施例は本発明の工程を実施する一方法に ついて記載する。

実施例

添附図面にて示されるタイプの反応器は、外径 が127mm、内径が76.2mmで、長さが152.4 mmのアルミニウム管によつて組立てられており、 と、0.3%のSiО2を作るに十分な塩化アルミ ニウムと 4塩化シリコンを含有する酸素と 4塩化 チタンとを予め混合して入れてあるジャケツトに よつて取巻かれている。

前記噴射装置の壁には、28の孔が14列合計20 図面の簡単な説明 392の孔が設けられた。各孔は最初のオリフイ スは直径1.19mm(0.047インチ)で、5.08 mm (0.2インチ)だけこの寸法で伸び、該孔の残 りの長さに対しては3.18㎜(0.125インチ) の直径に増加したオリフイスより成つている。 (1分間に129モルの)酸素が前記噴射装置の

8

上部に密封されたプラズマガン中で3.400° K の平均温度まで予熱され、しかる後入口 4を通じ て1分間に19モルの割合で前記反応器の中へ同 時に導入された。150℃に予熱された予め混合 面積のオリフイス11を通つて、周囲のジャケツ 5 された前記酸素、4塩化チタン、3塩化アルミニ ウム、4塩化シリコンは、1分間に酸素239モ ル、4塩化チタン248モルの割合で前記反応器 を取巻くジャケットの中へ導入された。

> 製造された2酸化チタンが回収され、これが優 10 秀な品質であることが判明した。

前記工程は上記の如く48時間操業されたが、 該操業後には噴射装置の壁には、特に前記孔の周 囲には殆どTiO。の附着が認められなかつた。

従来の経験では、同一条件のもとにおける同一 該反応器は \mathbf{T} i $\mathbf{O}_{\mathbf{z}}$ の重量の夫々 $\mathbf{2}$ $\mathbf{\mathcal{S}}$ の \mathbf{A} $\mathbf{1}_{\mathbf{z}}\mathbf{O}_{\mathbf{s}}$ $\mathbf{\mathcal{I}}$ 5 工程で、(上記孔の小さい方のオリフイスの断面 横と等しい)一定の断面積の孔の場合には、同一 時間内でも前記噴射装置の壁、特に孔の周囲に は著しいTiO。の附着が発生したことが知られ

添附図面は本発明の一実施例を示す。

1 ……入口、2 ……噴射装置(反応器)、3 … 出口、7……噴射装置の壁、9……ジャケット、 10……孔、11……小さい直径のオリフイス、 25 12……大きい直径のオリフイス。

